(19)日本国特計庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-27244

(43)公開日 平成5年(1993)2月5日

(51)Int.Cl.⁵ G 0 2 F 1/1337 識別記号 5 2 5

庁内整理番号 7610-2K

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平3-203634

(71)出願人 000004178

日本合成ゴム株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(22)出願日

平成3年(1991)7月19日

(72)発明者 宮本 剛

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 西川 通則

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 横山 泰明

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(74)代理人 弁理士 大島 正孝

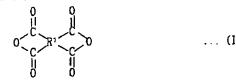
(54) 【発明の名称 】 液晶配向剤

(57)【要約】

(修正有)

【目的】プレチルト角が大きい液晶配向剤とする。

【構成】下記—般式(I)



基、シクロアルキル基もしくはビフェル構造を有する1 価の有機基。aはlまたは2。〕で表わされる化合物を 含有するジアミンとを反応させて得られる重合体および /またはそのイミド化重合体を含有する液晶配向剤。

〔R¹は4価の有機基。〕

で表わされるテトラカルボン酸二無水物および下記一般 式(11)

 $H_2N-R^2-NH_2$

... (11)

 $(R^3-R^4)_a$

[R²は3価または4価の有機基。R³は

から選ばれるいずれかの2価の有機基。R⁴ はアルキル

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(!)

1

* 【化1】

... (I)

ここでR1は4価の有機基を示す、

で表わされるテトラカルボン酸二無水物 および下記一 ※【化2】

般式(]])

 $H_2N-R^2-NH_2$ (R^3-R^4)

... (11)

ここでR²は3価または4価の有機基を示し、R³は -O-C-、

-NHC- および -O- から選ばれるいずれかの2価の有機基を示し、

R4はアルキル基、シクロアルキル基もしくはビフェニル構造を有する 1価の有機基を示し、そしてaは1または2を示す、

で表わされる化合物を含有するジアミンとを反応させて 得られる重合体および/またはそのイミド化重合体を含 有する、ことを特徴とする液晶配向剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶配向剤に関する。さらに詳しくは、液晶の配向性が良好でプレチルト角が大きい液晶配向剤に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、正の誘電異方性を有するネマチック型液晶を、ボリイミドなどからなる液晶配向膜を有する透明電極付き基板でサンドイッチ構造にし、液晶分子の長軸が基板間で90度連続的に捩じれるようにしてなるTN型配向セルを有する液晶表示素子(TN型表示素子)が知られている。とのTN型表示素子における液晶の配向は、ラビング処理が施された液晶配向膜により形成されている。

[0003] このTN型表示素子は、コントラストおよび視角依存性に劣るため、最近、コントラストおよび視角依存性に優れた液晶表示素子であるSBE(Super twisted Birefringency Effect)表示素子や、SH(Super Homeotropic)表示素子が開発されている。SBE表示素子は、液晶としてネマチック型液晶に光学活性物質であるカイラル剤をブレンドしたものを用い、液晶分子の長軸を基板間で180度以上連続的に捩じることにより生じる複屈折効果を利用するものである。またSH表50

示素子は、液晶分子の長軸方向の誘電異方性が負の液晶 を垂直配向させ、電圧付加により分子を倒して単純マト リクス駆動で動作させるものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、SBE 表示素子は、ポリイミドなどからなる液晶配向膜を用いて作製した場合には、液晶配向膜のプレチルト角が小さいため、液晶を基板間で180度以上捩じることができず、所要の表示機能を得ることが困難である。

【0005】とのため、現在のSBE表示素子の場合は、液晶を配向させるために、二酸化ケイ素を斜方蒸着して形成した液晶配向膜を用いる必要があり、製造工程が煩雑であるなどの問題がある。

るTN型配向セルを有する液晶表示素子(TN型表示素 子)が知られている。とのTN型表示素子における液晶 の配向は、ラビング処理が施された液晶配向膜により形 成されている。 「0003】とのTN型表示素子は、コントラストおよ び視角依存性に劣るため、最近、コントラストおよび視 角依存性に優れた液晶表示素子であるSBE(Super tw

【0007】本発明の目的は、前記従来技術の問題を解決し、液晶の配向性が良好でプレチルト角が大きく、SBEおよびSH表示素子の液晶配向膜用として特に好適に用いることができる液晶配向剤を提供することにある

0 [0008]

ここでR1は4価の有機基を示す、

[0010] で表わされるテトラカルボン酸二無水物 ※ [0012] (以下「化合物 I」という)および 【化4】 【0011] 下記一般式 (II) ※ H₂N-R²-NH₂ ... (II)

ここでR²は3価または4価の有機基を示し、R³は -O-C-、

-NHC- および -O- から選ばれるいずれかの2価の有機基を示し、 | | O

R4はアルキル基、シクロアルキル基もしくはビフェニル構造を有する 1価の有機基を示し、そしてaは1または2を示す、

[0013]で表わされる化合物(以下「化合物 II」という)を含有するジアミンとを反応されて得られる重合体(以下「特定重合体 I」という)および/またはそのイミド化重合体(以下「特定重合体 II」という)を含有する、ことを特徴とする液晶配向剤によって達成される。

【0014】本発明における一般式(I)中のR¹は4 価の有機基を示す。4価の有機基とはテトラカルボン酸 二無水物から酸無水物基を除いた残基である。

【0015】かかる化合物 I としては、例えばブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、2,3,5ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、3,5,6ートリカルボキシーノルボルナンー2ー酢酸二無水物、2,3,4,5ーテトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9bーへキサヒドロー5ー(テトラヒドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト [1,2-c] フランー1,3ージオン、5ー(2,5ージオキソテトラヒドロフリル)ー3ーメチルー3ーシクロへキセンー1,2ージカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2]ーオクトー7ーエンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物などの脂肪族および脂環式テトラカルボン酸二無水物;

【0016】ピロメリット酸二無水物、3,3',4,

4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3, 3'.4.4'ーピフェニルスルホンテトラカルボン酸二 無水物、1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、3,3',4,4'ービフェニルエーテルテトラ カルボン酸二無水物、3,3',4,4'ージメチルジフ ェニルシランテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ーテトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水 物、1,2,3,4ーフランテトラカルボン酸二無水物、 4,4'ービス(3,4ージカルボキシフェノキシ)ジフ ェニルスルフィド二無水物、4,4'ーピス(3,4ージ カルボキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物、 4.4'ーピス(3.4ージカルボキシフェノキシ)ジフ ェニルプロパン二無水物、3,3',4,4'ーパーフル オロイソプロピリデンテトラカルボン酸二無水物、3, 3',4,4'ーピフェニルエーテルテトラカルボン酸二 無水物、ビス(フタル酸)フェニルホスフィンオキサイ ド二無水物。 p-フェニレンービス(トリフェニルフタ ル酸) 二無水物、m-フェニレンービス(トリフェニル フタル酸) 二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)ー 4.4'ージフェニルエーテル二無水物、ビス(トリフ ェニルフタル酸) ー4,4'ージフェニルメタン二無水 物などの芳香族テトラカルボン酸二無水物を挙げること ができる。これらのうちでは2,3,5ートリカルボキシ 50 シクロベンチル酢酸二無水物、1,2,3,4ーシクロブ

タンテトラカルボン酸二無水物、5-(2,5-ジオキ ソテトラヒドロフリル) ー3ーメチルシクロヘキセンー 1.2 ージカルボン酸二無水物およびビ1,3,3 a,4, 5.9b-ヘキサヒドロー5ー (テトラヒドロー2,5ー ジオキソー3ーフラニル)ーナフト[1,2ーc]フラ ンー1.3ージオンが好ましい。

[0017] 化合物 []は、一般式([])で表わされ る。一般式(II)中、R'は3価(aが1であると き)または4価(aが2であるとき)の有機基を示す。 【0018】かかる化合物 | | は、例えば特定の反応性 10 基を有するジニトロ化合物とアルキル基、シクロアルキ ル基もしくはビフェニル構造を有する化合物(以下、ア ルキル基を有する化合物を「アルキル化合物」、シクロ アルキル基を有する化合物を「シクロアルキル化合 物」、ビフェニル構造を有する化合物を「ビフェニル化 合物」とそれぞれいう)を反応せしめたのち、ニトロ基

【0019】すなわち、上記一般式(II)中、R'は 後述するかかる特定のジニトロ化合物からニトロ基を除 外した残基部分を意味する。

【0020】また、R*は2価の有機基であり、

- -O-C (=O) -
- -NH-C(=O)- および

を還元することによって得られる。

-0-

より選ばれる有機基を示す。

【0021】さらに、パはアルキル基、シクロアルキル 基もしくはビフェニル構造を有する1価の有機基を示 す。

【0022】以下、化合物IIを、Riの上記2価の有機 基ごとに、その例と製造法を詳述する。

【0023】R3が-O-C(=O)-の構造を有する 化合物 I I は、水酸基を有するジニトロ化合物と酸クロ ライド基を有するアルキル化合物、シクロアルキル化合 物もしくはビフェニル化合物を溶媒中、塩基性触媒の存 在下で反応させた後、その生成物を還元してニトロ基を アミノ基に変換することによって得られる。

【0024】水酸基を有するジニトロ化合物としては、 例えば4,6ージニトローロークレゾール、3,5ージニ トロ-o-クレゾール、2,4ージニトロフェノール、 ル、4,4'ーメチレンービス(2ーヒドロキシニトロ ベンゼン)、3,3'ージヒドロキシー4,4'ージニト ロビフェニルエーテル、3,3'ージヒドロキシー4, 4'ージニトロビフェニルなどを挙げることができる。 【0025】酸クロライド基を有するアルキル化合物と しては、例えば下記式

C. Hz., COCI

ここでnは8以上の数であるで表わされる直鎖状もしく は分岐鎖状の化合物が好ましく用いられる。

[0026]具体的には、ノナン酸クロライド、ウンデ 50 トキシ)ベンゾイルクロライド、4-(4'ートリフル

カン酸クロライド、トリデカン酸クロライド、ペンタデ カン酸クロライド、ヘプタデカン酸クロライド、ノナデ カン酸クロライド、ヘンイコサン酸クロライドなどが挙 げられる。

6

【0027】酸クロライド基を有するシクロアルキル化 合物としては、例えば

アビエティク酸クロライド、1ーアダマンタンカルボン 酸クロライド、シクロヘキサンカルボン酸クロライド、 4-n-ブチルシクロヘキサンカルボン酸クロライド、 4 - tert-ブチルシクロヘキサンカルボン酸クロライ ド、シクロブタンカルボン酸クロライド、3ーシクロへ キセンー1ーカルボン酸クロライド、シクロペンタンカ ルボン酸クロライド、シクロプロパンカルボン酸クロラ イド、1ーメチルーシクロヘキサンカルボン酸クロライ ド、1ーメチルーシクロプロパン-1-カルボン酸クロ ライド、5ーノルボルニル-2-カルボン酸クロライ ド、4-n-ペンチルシクロヘキサンカルボン酸クロラ イド、デカヒドロー2ーナフチルカルボン酸クロライ ۴.

【0028】4-(4'-シアノフェニル)シクロヘキ 20 サンカルボン酸クロライド、4-(4'-フルオロフェ ニル)シクロヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'-トリフルオロメトキシフェニル)シクロヘキサ ンカルボン酸クロライド、4- (4'-ジフルオロメト キシフェニル) シクロヘキサンカルボン酸クロライド、 4-(4'-トリフルオロメチルフェニル)シクロヘキ サンカルボン酸クロライド、4-(4'-シアノシクロ ヘキシル)シクロヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'-フルオロシクロヘキシル)シクロヘキサンカル 30 ボン酸クロライド、4-(4'-トリフルオロメトキシ シクロヘキシル) シクロヘキサンカルボン酸クロライ ド、4-(4'-ジフルオロメトキシシクロヘキシル) シクロヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'-ト リフルオロメチルシクロヘキシル) シクロヘキサンカル ボン酸クロライド、4-(4'-フルオロシクロヘキシ ル)シクロヘキサンカルボン酸クロライドなどを挙げる ことができる。

【0029】酸クロライド基を有するピフェニル化合物 としては、例えば

2.6ージニトロフェノール、2.5ージニトロフェノー 40 4-(4'ーシアノフェニル)ベンゾイルクロライド、 4-(4'ープチルフェニル)ベンゾイルクロライド、 4-(4'ーペンチルフェニル)ベンゾイルクロライ ド、4-(4'ーヘキシルフェニル)ベンゾイルクロラ イド、4-(4'ーブトキシフェニル)ベンゾイルクロ ライド、4-(4'ーペントキシフェニル)ベンゾイル クロライド、4-(4'ーヘキソキシフェニル)ベンゾ イルクロライド、4-(4'ートリフルオロメチル)べ ンゾイルクロライド、4-(4'ートリフルオロメトキ シ) ベンゾイルクロライド、4-(4'ージフルオロメ オロメチルフェニル) シクロヘキサンカルボン酸クロラ イド、4-(4'ートリフルオロメトキシフェニル)シ クロヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'ージフ ルオロメトキシフェニル) シクロヘキサンカルボン酸ク ロライド、4-(4'ートリフルオロメチルシクロヘキ シル) ベンゾイルクロライド、4-(4'ートリフルオ ロメトキシシクロヘキシル) ベンゾイルクロライド、4 - (4' ージフルオロメトキシシクロヘキシル) ベンゾ イルクロライド、

[0030]4-(4'ートリフルオロメチルシクロへ 10 キシル)シクロヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'ートリフルオロメトキシシクロヘキシル)シクロ ヘキサンカルボン酸クロライド、4-(4'ージフルオ ロメトキシシクロヘキシル) シクロヘキサンカルボン酸 クロライド、4-(4'-シアノフェニル)ベンゾイル クロライド、4-(4'-フルオロフェニル)ベンゾイ ルクロライド、4-(4'-トリフルオロメトキシフェ ニル) ベンゾイルクロライド、4-(4'-ジフルオロ メトキシフェニル)ベンゾイルクロライド、4-(4' - トリフルオロメチル) ベンゾイルクロライドなどを挙 20 げるととができる。

【0031】 これらの水酸基を有するジニトロ化合物と 酸クロライド基を有するアルキル化合物、シクロアルキ ル化合物またはビフェニル化合物との反応に用いられる 溶媒としては、例えばトルエン、ベンゼン、テトラヒド ロフラン、ジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、 メチルブチルエーテル、ジクロロメタンなどを挙げるこ とができる。また、塩基性触媒としては例えばピリジ ン、トリエチルアミンなどを挙げることができる。

【0032】反応生成物の還元反応には、例えば亜鉛、 鉄、スズ、塩化スズ(II)、硫化ナトリウム(Na, S, Na、S、, Na、Sx)、ナトリウムヒドロスルフィド、亜ニチ オン酸ナトリウム、硫化アンモニウムなどの還元剤が有 利に用いられる。また、例えばパラジウム-炭素、白 金、ラネーニッケル、白金黒、ロジウムーアルミナ、硫 化白金炭素などを触媒とし、水素ガス、ヒドラジン、塩 酸などによって還元を行うこともできる。

【0033】還元反応の溶媒としては、例えばエタノー ル、メタノール、2ープロパノールなどのアルコール、 ジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、メチルブチ 40 ルスルフィド、2ークロロー3,5ージニトロビリジ ルエーテルなどのエーテル、アンモニア水、トルエン、 水、テトラヒドロフラン、クロロホルムまたはジクロロ メタンが用いられる。

【0034】R³が-NH-C(=O)-の構造を有す る化合物 1 1は、アミノ基を有するジニトロ化合物と酸 クロライド基を有するアルキル化合物、シクロアルキル 化合物、ビフェニル化合物を溶媒中、塩基性触媒の存在 下で反応させた後、その生成物を還元してニトロ基をア ミノ基に変換することによって得られる。

【0035】アミノ基を有するジニトロ化合物として

は、例えば6-クロロー2,4-ジニトロアニリン、2, 4ージニトロアニリン、2,6ージニトロアニリン、5, 5'ーメチレンービス(1ーニトロアニリン)、3, 3'ージアミノー4,4'ージニトロジフェニルエーテ ル、3,3'ージアミノー4,4'ージニトロピフェニル などを挙げることができる。

【0036】酸クロライド基を有するアルキル化合物、 シクロアルキル化合物およびビフェニル化合物としては 先に記載したものと同様の化合物が用いられる。

【0037】アミノ基を有するジニトロ化合物と酸クロ ライド基を有するアルキル化合物、シクロアルキル化合 物およびビフェニル化合物との反応に用いられる溶媒、 塩基性触媒および得られた生成物の還元には上記同種の 反応について記述したものと同様の化合物が用いられ

【0038】R³が-O-の構造を有する化合物II は、水酸基を有するジニトロ化合物とハロゲン基を有す るアルキル化合物、シクロアルキル化合物、ビフェニル 化合物を塩基性触媒の存在下で反応させるかあるいはハ ロゲン基を有するジニトロ化合物と水酸基を有するアル キル化合物、シクロアルキル化合物、ビフェニル化合物 を適当な触媒の存在下で反応させた後、ニトロ基を還元 してアミノ基に変換することにより得られる。

【0039】水酸基を有するジニトロ化合物としては、 前記した化合物と同様のものを例として挙げることがで

【0040】ハロゲン基を有するアルキル化合物として は、例えば下記式

 $C_n H_{2n+1} C l$

30 とこでmは8以上の数であるで表わされる直鎖状もしく は分岐鎖状の化合物を好適なものとして挙げることがで

【0041】具体的な化合物としては、例えばクロロオ クタン、クロロデカン、クロロドデカン、クロロテトラ ドデカン、クロロヘキサデカン、クロロオクタデカン、 クロロエイコサンなどが挙げられる。

【0042】ハロゲン基を有するジニトロ化合物として は、例えば4,6ージフルオローmージニトロベンゼ ン、p,p'ージフルオローm,m'ージニトロジフェニ ン、4,4'ーメチレンービス(2ークロロベンゼ ン)、4.4'ーメチレンービス(2ーブロモベンゼ ン)、3,3'ージクロロー4,4'ージニトロジフェニ ルエーテル、3,3'ージプロモー4,4'ージニトロジ フェニルエーテル、3,3'ージクロロー4,4'ージニ トロビフェニル、3,3'ージブロモー4,4'ージニト ロビフェニルなどを挙げることができる。

【0043】ハロゲン基を有するシクロアルキル化合物 としては、例えば

50 塩化シクロプロパン、臭化シクロプロパン、塩化シクロ

ブタン、奥化シクロブタン、塩化シクロベンタン、奥化 シクロペンタン、塩化シクロヘキサン、臭化シクロヘキ サン、塩化シクロヘプタン、臭化シクロヘプタン、塩化 シクロオクタン、奥化シクロオクタン、1-塩化アダマ ンタン、1-奥化アダマンタン、2-塩化アダマンタ ン、2-奥化アダマンタン、4-(4'-シアノフェニ ル) クロロシクロヘキサン、4-(4'-フルオロフェ ニル) クロロシクロヘキサン、4-(4'-トリフルオ ロメトキシフェニル) クロロシクロヘキサン、4-(4'-ジフルオロメトキシフェニル) クロロシクロへ 10 テル、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素、アセ キサン、4-(4'ートリフルオロメチルフェニル)ク ロロシクロヘキサン、4-(4'ーシアノシクロヘキシ ル) クロロシクロヘキサン、4-(4'-フルオロシク ロヘキシル)クロロシクロヘキサン、4-(4'ートリ フルオロメトキシシクロヘキシル) クロロシクロヘキサ ン、4-(4'ージフルオロメトキシシクロヘキシル) クロロシクロヘキサン、4-(4'ートリフルオロメチ

【0044】ハロゲン基を有するビフェニル化合物とし 20 ては、例えば

ルシクロヘキシル) クロロシクロヘキサンなどを挙げる

とができる。

4-(4'ートリフルオロメチルフェニル)クロロシク ロヘキサン、4-(4'ートリフルオロメチルフェニ ル) プロモシクロヘキサン、4-(4'-トリフルオロ メトキシフェニル)クロロシクロヘキサン、4-(4' ートリフルオロメトキシフェニル) ブロモシクロヘキサ ン、4-(4'ージフルオロメトキシフェニル)クロロ シクロヘキサン、4-(4'ージフルオロメトキシフェ ニル) プロモシクロヘキサン、4-トリフルオロメチル -4'-クロロビシクロヘキサン、4-トリフルオロメ チルー4' - ブロモビシクロヘキサン、4 - トリフルオ ロメトキシー4'-クロロビシクロヘキサン、4-トリ フルオロメトキシー4'ープロモビシクロヘキサン、4 -ジフルオロメトキシ-4'-クロロビシクロヘキサ ン、4-ジフルオロメトキシ-4'-ブロモビシクロへ キサン、4-(4'-シアノフェニル)クロロベンゼ ン、4-(4'-フルオロフェニル)クロロベンゼン、 4-(4'-トリフルオロメトキシフェニル)クロロベ ンゼン、4-(4'-ジフルオロメトキシフェニル)ク ロロベンゼン、4-(4'-トリフルオロメチルフェニ 40 ル) クロロベンゼンドなどを挙げることができる。

【0045】これらの水酸基を有するニトロ化合物とハ ロゲン基を有するアルキル化合物、シクロアルキル化合 物またはビフェニル化合物との反応に用いられる溶媒と しては、例えばトルエン、ベンゼン、テトラヒドロフラ ン、ジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、メチル ブチルエーテル、アセトン、水、ジメチルスルホキシド (DMSO)、 ヂメチルホルムアミド (DMF)、メタ ノール、エタノール、2ープロパノール、n - プタノー ルなどを、触媒としては、例えば水酸化ナトリウム、水 50 シ)フェニル]ヘキサフルオロプロパンなどのヘテロ原

酸化カリウム、酸化バリウム、水素化ナトリウムなどを 挙げることができる。

10

【0046】また、生成物の還元には上記同種の反応に ついて記述したものと同じ化合物が用いられる。

【0047】また、ハロゲン基を有するジニトロ化合物 と水酸基を有するアルキル化合物、シクロアルキル化合 物、ビフェニル化合物との反応に用いられる溶媒として は、例えばジエチルエーテル、メチルエチルエーテル、 メチルブチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエー トン、ジメチルスルホキシドおよびジメチルホルムアミ ドが、触媒としてはヨウ化第一銅、銅粉などが挙げられ る。得られた生成物の還元には上記同種の反応について 記述したものと同様の化合物が用いられる。

【0048】本発明に用いられる特定重合体 [は、化合 物」と化合物「」とを反応させて得られる。かかる反応 は有機溶媒中で、通常0~150℃、好ましくは0~1 00℃の反応温度で行なわれる。化合物Ⅰと化合物ⅠⅠ の使用割合は化合物 [] 中のアミノ基1当量に対して化 合物 I の酸無水物基を 0.2~2 当量とするのが好まし く、より好ましくは0.3~1.2当量である。

【0049】前記特定重合体 I の製造においては、化合 物 I I の他に、本発明の効果を失わない範囲で、他のジ アミン化合物を併用することができる。この他のジアミ ン化合物としては、例えばp-フェニレンジアミン、m -フェニレンジアミン、4,4´-ジアミノジフェニル メタン、4,4′-ジアミノジフェニルエタン、4,4′ -ジアミノジフェニルスルフィド、4,4´-ジアミノ ジフェニルスルホン、4,4~-ジアミノジフェニルエ ーテル、1,5-ジアミノナフタレン、3,3 -ジメチ ルー4,4´ージアミノビフェニル、3,4´ージアミノ ベンズアニリド、4,4′-ジアミノジフェニルエーテ ル、3,3~-ジアミノベンゾフェノン、3,4~-ジア ミノベンゾフェノン、4,4´-ジアミノベンゾフェノ ン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェ ニル] プロパン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル]スルホン、1,4-ビス(4-アミノフェノ キシ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフェノキ シ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ) ベンゼン、9,9-ビス(4-アミノフェニル)-10 -ヒドロ-アントラセン、9,9-ビス(4-アミノフ ェニル) フルオレン、4,4 - メチレンービス (2-クロロアニリン)、2,2~5,5~-テトラクロロー 4,4 -ジアミノピフェニル、2,2 -ジクロロー 4,4´-ジアミノ-5,5´-ジメトキシピフェニル、 3,3 ´ージメトキシー4,4 ´ージアミノビフェニルな どの芳香族ジアミン;ジアミノテトラフェニルチオフェ ン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)へキサフルオ ロプロパンおよび2,2-ビス[(4-アミノフェノキ

子を有する芳香族ジアミン;1,1-メタキシリレンジ アミン、1,3-プロパンジアミン、テトラメチレンジ アミン、ベンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジア ミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミ ン、ノナメチレンジアミン、4,4-ジアミノヘプタメ チレンジアミン、1,4-ジアミノシクロヘキサン、イ ソホロンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジェニ レンジアミン、ヘキサヒドロー4,7-メタノインダニ レンジメチレンジアミン、トリシクロ[6,2,1, 0''] - ウンデシレンジメチルジアミンなどの脂肪族 または脂環族ジアミン;

[0050]

【式5】

【0051】ととで、Rはメチル基、エチル基、プロピ ル基などのアルキル基、シクロヘキシル基などのシクロ アルキル基またはフェニル基などのアリール基のような 炭素数1~12の炭化水素基を示し、pは1~3、gは 1~20の整数を示す、などで表わされるジアミノオル ガノシロキサンが挙げられる。これらの中でp-フェニ レンジアミンおよび2,2-ビス(4-アミノフェニ ル)ヘキサフルオロプロバンが好ましい。

【0052】かかる他のジアミン化合物の使用は、全ジ アミン化合物(化合物 I I および他のジアミン化合物) 中、通常0~99.99モル%、好ましくはTNおよび STN表示素子に用いる場合には80~99.9モル %、SH表示素子に用いる場合では0~50モル%であ

【0053】化合物Iと全ジアミン化合物の使用割合 は、全ジアミン化合物中のアミノ基1当量に対して化合 物 I の酸無水物基を0.2~2当量とするのが好まし く、より好ましくは0.3~1.2当量である。

【0054】反応に用いられる有機溶媒としては、反応 で生成する特定重合体Iを溶解しうるものであれば特に 制限はない。例えばN-メチル-2-ピロリドン、N、 N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムア ミド、ジメチルスルホキシド、ャーブチロラクトン、テ トラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミドなど の非プロトン系極性溶媒およびm-クレゾール、キシレ ノール、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェ ノール系溶媒を挙げることができる。有機溶媒の使用量 40 は、通常、化合物 I および全ジアミン化合物の総量が、 反応溶液の全量に対して0.1~30重量%になるよう にするのが好ましい。

【0055】本発明に用いられる特定重合体 I I は、上 記した特定重合体Ⅰを、加熱して、または脱水剤および イミド化触媒の存在下でイミド化することにより得られ る。加熱によりイミド化する場合の反応温度は、通常6 0~200℃、好ましくは100~170℃である。反 応温度が60℃未満では反応の進行が遅れ、また200 ℃を超えると特定重合体IIの分子量が大きく低下する 50 ン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノ-プロビル

ことがある。また脱水剤およびイミド化触媒の存在下で イミド化する場合の反応は、前記した有機溶媒中で行う ことができる。反応温度は、通常0~180℃、好まし くは60~150℃である。脱水剤としては、無水酢 酸、無水プロピオン酸、無水トリフルオロ酢酸などの酸 無水物を用いることができる。またイミド化触媒として は、例えばピリジン、コリジン、ルチジン、トリエチル アミンなどの3級アミンを用いることができるが、これ らに限定されるものではない。脱水剤の使用量は、特定 10 重合体 [の繰り返し単位] モルに対して] .6~20 モ ルとするのが好ましい。またイミド化触媒の使用量は、 使用する脱水剤1モルに対し、0.5~10モルとする のが好ましい。

【0056】なお、前記有機溶媒には、貧溶媒であるア ルコール類、ケトン類、エステル類、エーテル類、ハロ ゲン化炭化水素類、芳香族炭化水素類を、生成する重合 体が析出しない程度に併用することができる。かかる貧 溶媒としては、例えばメチルアルコール、エチルアルコ ール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサノール、 20 エチレングリコール、プロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、トリエチレングリコール、エチレング リコールモノメチルエーテル、アセトン、メチルエチル ケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、 酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、シュウ酸ジエチ ル、マロン酸ジエチル、ジエチルエーテル、エチレング リコールメチルエーテル、エチレングリコールエチルエ ーテル、エチレングリコール-n-プロピルエーテル、 エチレングリコールー i - プロピルエーテル、エチレ ングリコール-n-ブチルエーテル、エチレングリコー 30 ルジメチルエーテル、エチレングリコールエチルエーテ ルアセテート、ジェチレングリコールジメチルエーテ ル、テトラヒドロフラン、ジクロルメタン、1,2-ジ クロルエタン、1,4-ジクロルブタン、トリクロルエ タン、クロルベンゼン、o-ジクロルベンゼン、ヘキサ ン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレ ンなどを挙げることができる。

【0057】 このようにして得られる特定重合体 1 また はllの固有粘度 [ninh=(ln nrel/C. C=0.5g/d1、30℃、N-メチル-2-ピロリ ドン中、以下同条件にて固有粘度を測定〕は、通常、 0.05~10d1/g、好ましくは0.05~5d1/

【0058】本発明の液晶配向剤は、基板との接着性を 改善する目的で、官能性シラン含有化合物を含有すると とができる。

【0059】官能性シラン含有化合物としては、例えば 3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプ ロビルトリエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメ トキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラ

トリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノープロビルメチルジメトキシシラン、3-ウレイ ドープロピルトリメトキシシラン、 3-ウレイドープ ロピルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノ-プロピルトリメトキシシラン、N-エトキ シカルボニルー3ーアミノープロビルトリエトキシシラ ン、N-トリメトキシシリルプロピル-トリエチレント リアミン、N-トリエトキシシリルプロピルートリエチ レントリアミン、10-トリメトキシシリル-1,4,7 7-トリアザデカン、9-トリメトキシシリル-3,6 -ジアザノニルアセテート、9-トリエトキシシリル-3,6-ジアザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジル-3 -アミノ-プロビルトリエトキシシラン、N-フェニル -3-アミノ-プロピルトリメトキシシラン、N-フェ ニル-3-アミノープロピルトリエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノ - プロピルトリエトキシシランなどが挙げられる。

[0060] 本発明の液晶配向剤を用いて得られる液晶 表示素子は、例えば次の方法によって製造することがで きる。

[0061]まず透明導電膜が設けられた基板の透明導 電膜側に、本発明の液晶配向剤をロールコーター法、ス ピンナー法、印刷法などで塗布し、80~200℃、好 ましくは120~200℃の温度で加熱して塗膜を形成 させる。この塗膜の膜厚は、通常、0.001~1ル m、好ましくは $0.005\sim0.5\mu m$ である。

[0062]形成された塗膜は、ナイロンなどの合成繊 維からなる布を巻きつけたロールでラビング処理を行な うことにより、液晶配向膜とされる。

【0063】上記基板としては、例えばフロートガラ ス、ソーダガラスなどのガラスおよびポリエチレンテレ フタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテ ルスルホン、ポリカーボネートなどのプラスチックフィ ルムなどからなる透明基板を用いることができる。

[0064]上記透明導電膜としては、SnO₂からなる NESA膜、In2O,-SnO2からなるITO膜など を用いることができ、これらの透明導電膜のパターニン グには、フォト・エッチング法、予めマスクを用いる方 法などが用いられる。

【0065】液晶配向剤の塗布に際しては、基板および 诱明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするため に、基板および透明導電膜上に、あらかじめ官能性シラ ン含有化合物、チタネートなどを塗布することもでき

[0066]液晶配向膜が形成された基板は、その2枚 を液晶配向膜面をラビング方向が直交または逆平行とな るように対向させ、基板の間の周辺部をシール剤でシー 50 合成例1で得られたジニトロ化合物20gをエタノール

ルし、液晶を充填し、充填口を封止して液晶セルとし、 その両面に偏光方向がそれぞれ基板の液晶配向膜のラビ ング方向と一致または直交するように張り合わせること により液晶表示素子とされる。

【0067】上記シール剤としては、例えば硬化剤およ びスペーサーとしての酸化アルミニウム球を含有したエ ポキシ樹脂などを用いることができる。

【0068】上記液晶としては、ネマティック型液晶、 スメクティック型液晶、その中でもネマティック型液晶 --トリアザデカン、10-トリエトキシシリル-1,4, 10 を形成させるものが好ましく、例えばシッフベース系液 晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フェニルシク ロヘキサン系液晶、エステル系液晶、ターフェニル系液 晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ビリミジン系液 晶、ジオキサン系液晶、ビシクロオクタン系液晶、キュ バン系液晶などが用いられる。またこれらの液晶に、例 えばコレスチルクロリド、コレステリルノナエート、コ レステリルカーボネートなどのコレステリック液晶や商 品名C-15、CB-15 (ブリティッシュドラックハ ウス社製)として販売されているようなカイラル剤など 20 を添加して使用することもできる。さらにp-デシロキ シベンジリデン-p^-アミノ-2-メチルブチルシン ナメートなどの強誘電性液晶も使用することができる。 【0069】液晶セルの外側に使用される偏光板として は、ポリビニルアルコールを延伸配向させながら、ヨウ 素を吸収させたH膜と呼ばれる偏光膜を酢酸セルロース 保護膜で挟んだ偏光板、またはH膜そのものからなる偏 光板などを挙げることができる。

[0070]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるもの ではない。

【0071】なお、実施例中におけるプレチルト角の測 定は、[T.J. Schffer, et al., J.Appl. Phys., 48, 1 783 (1977), F. Nakano, et al., JPN., J. Appl. Phy s., 19, 2013 (1980)] に記載の方法に準拠し、He‐ Neレーザー光を用いる結晶回転法により行った。

[0072]また、液晶表示素子の配向性評価は、電圧 をオン・オフさせた時の異常ドメインの有無を偏光顕微 鏡で観察し、異常ドメインのない場合良好と判定した。 【0073】合成例1

2,5-ジニトロフェノール18.4gおよびペンタデカ ン酸クロライド26.1gをトルエン500gに溶解さ せた後、ピリジン23.73gを徐々に滴下し、25℃ で10時間反応を行った。

【0074】次いで、反応液を炭酸水素ナトリウム水溶 液で3回洗浄した後、トルエンを除去した。その後、エ タノールを用いて再結晶を行い、淡黄色のジニトロ化合 物32.7gを得た。

【0075】合成例2

200gに溶解させ、Pd/C 0.1gおよびヒドラ ジン1水和物20gを添加し、6時間還流して水添を行 い、化合物 I I a 8.08 g を得た。

【0076】合成例3

2.3.5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水和 物37.7g、pーフェニレンジアミン16.4gおよび 化合物11a 5.9gをNーメチルー2ーピロリドン5 40gに溶解させ、室温で6時間反応させた。

[0077]次いで反応混合物を大過剰のメタノール中 に注ぎ、反応生成物を沈澱させた。その後、メタノール 10 で洗浄し、減圧下で、40℃で15時間乾燥させて、固 有粘度0.94dl/gの特定重合体 la 43.44g を得た。

[0078]合成例4

合成例3で得られた特定重合体 I a 20.0gを380 gのγープチロラクトンに溶解し、ピリジン 22.14 gと無水酢酸16.22gを添加し、120℃で3時間 イミド化反応をさせた。

【0079】次いで反応生成液を合成例1と同様に沈澱 させ、固有粘度0.94dl/gの特定重合体IIa l 1.11gを得た。

【0080】合成例5

合成例1において、酸クロライドを有する化合物を1-アダマンタンカルボン酸クロライド19.7gとした以 外は合成例1と同様にしてジニトロ化合物34.4gを 得た。

【0081】合成例6

合成例2において、ジニトロ化合物を合成例5で得られ たジニトロ化合物25.00gとした以外は合成例2と 同様にして化合物 I I b 11.44gを得た。

【0082】合成例7

合成例3において、酸無水物を38.44g、pーフェ ニレンジアミンを16.69gおよび化合物 I l a を化 合物 IIb 4.81gとした以外は合成例3と同様にし て特定重合体Ibを得、さらにこの特定重合体Ibを用 いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度 1.18d1/gの特定重合体IIb 12.45gを得 た。

【0083】合成例8

シアノフェニル) ベンゾイルクロライド24.2gをト ルエン500gに溶解させた後、ビリジン23.7gを 徐々に滴下し、25℃で10時間反応させた。

【0084】次いで、反応液を炭酸水素ナトリウム水溶 液で3回洗浄した後、トルエンを除去した。その後、エ タノールを用いて再結晶を行い、淡黄色のジニトロ化合 物21.0gを得た。

【0085】合成例9

合成例8で得られたジニトロ化合物20gをエタノール

ジン1水和物20gを添加し、6時間還流して水添し、 化合物 IIc 7.92 gを得た。

16

[0086] 合成例10

合成例3において、酸無水物を37.9g、pーフェニ レンジアミンを16.5g、および化合物 IIcを5.6 gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体 I cを 得、さらにこの特定重合体 I c を用いて合成例4と同様 にイミド化反応を行い、固有粘度 1.12 d 1/gの特 定重合体 IIc 11.40 gを得た。

【0087】合成例11

2. 5-ジニトロフェノール18.41g、1-クロロ ヘキサデカン26.1gおよび水酸化カリウム16.8g をエタノール400gに溶解させた。8時間還流させた 後、析出物を濾別し、エタノールから再結晶を行い、ジ ニトロ化合物32.3gを得た。

[0088]合成例12

合成例11で得られたジニトロ化合物20gをエタノー ル200gに溶解させ、Pd/C 0.1gおよびヒドラ ジン1水和物10gを添加し、8時間還流し、水添し た。室温まで冷却した後、析出物を濾別し、エタノール を用いて再結晶を行い、化合物 I I d 8.42gを得

【0089】合成例13

合成例3において、酸無水物を40.18g、p-フェー ニレンジアミンを19.19g、および化合物 I I aを 化合物 I I d 0.62 g とした以外は合成例 3 と同様に して特定重合体 1 dを得、さらにこの特定重合体 1 dを 用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度 1.18dl/gの特定重合体IId 11.33gを得 30 た。

【0090】合成例14

合成例3において、酸無水物を39.06g、pーフェ ニレンジアミンを17.90g、および化合物IIaを 化合物 I I d 3.34 g とした以外は合成例3と同様に して特定重合体 I e を得、さらにこの特定重合体 I e を 用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度 1.00dl/gの特定重合体IIe 13.00gを得 た。

【0091】合成例15

2,4-ジニトロアニリン18.5gおよび4- (4'- 40 合成例11において、1-クロロヘキサデカンを1-塩 化アダマンタン 17.1gとした以外は合成例11と同 様にしてジニトロ化合物 20.31gを得た。

【0092】合成例16

合成例12において、ニトロ基を有する化合物を合成例 15で得られたジニトロ化合物 20gとした以外は合 成例12と同様にして化合物 I I e 10.21gを得

【0093】合成例17

合成例3において、酸無水物を40.29g、pーフェ 200gに溶解させ、Pd/C 0.1gおよびヒドラ 50 ニレンジアミンを19.24g、および化合物IIaを

化合物 I I e 0.46 gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体 I fを得、さらにこの特定重合体 I fを用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度 1.00d1/gの特定重合体 I I f 8.42 gを得た。

[0094]合成例18

合成例3において、酸無水物を39.58g、pーフェニレンジアミンを18.14g、および化合物IIaを化合物IIe 2.28gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体Igを得、さらにこの特定重合体Igを用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度0.84d1/gの特定重合体IIg 8.33gを得た。

【0095】合成例19

合成例11において、1-クロロヘキサデカンを4-(4'-トリフルオロメトキシフェニル) クロロシクロヘキサン 40.21 g とした以外は合成例11と同様にしてジニトロ化合物 40.21 g を得た。

[0096]合成例20

合成例 12 において、ニトロ基を有する化合物を合成例 19 で得られたジニトロ化合物 20.00 g とした以外 は合成例 19 と同様にして化合物 II g 11.11 g を 得た。

【0097】合成例21

合成例3において、酸無水物を40.11g、pーフェニレンジアミンを19.16g、および化合物IIaを化合物IIf 0.73gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体Ihを得、さらにこの特定重合体Ihを用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度1.02d1/gの特定重合体IIh 8.31gを得た。

[0098]合成例22

合成例3において、酸無水物を38.72g、p-フェニレンジアミンを<math>17.75g、および化合物 IIae 化合物 IIf3.53g とした以外は合成例3と同様にして特定重合体 Iie の特定重合体 Iie 用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度0.82d I/g の特定重合体 Ii 9.12g を得た。

【0099】合成例23

合成例3において、酸無水物を7.78gならびに化合物 IIとして pーフェニレンジアミン 2.81g、2,2ーピス (4ーアミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン1.70gおよび化合物 IIbを0.93gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体 Ijを得、さらにこの特定重合体 Ijを用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度0.98d1/gの特定重合体 IIj 10.44gを得た。

[0100]合成例24

合成例18において、p-フェニレンジアミンの代わり

18

に4、4'-ジアミノジフェニルメタン 33.26gとした以外は合成例18と同様にして特定重合体 I kを得、さらにこの特定重合体 I kを用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度 0.78 d 1 / g の特定重合体 I I k 40.22gを得た。

[0101]合成例25

合成例3 において、酸無水物を40.47g、pーフェニレンジアミンを19.52gとした以外は合成例3と同様にして特定重合体11を得、さらにこの特定重合体10 I1を用いて合成例4と同様にイミド化反応を行い、固有粘度1.40d1/gの特定重合体II1 12.00gを得た。

【0102】実施例1

合成例3で得られた重合体1a3ge γ -ブチロラクトン 72g に溶解させて固形分濃度4重量%の溶液とし、この溶液を孔径 1μ mのフイルタで濾過し、液晶配向剤溶液を調製した。

[0103] この溶液を、ITO膜からなる透明電極付きガラス基板上の透明電極面に、スピナーを用いて塗布 20 し回転数3,000rpmで3分間、180℃で1時間 乾燥し、乾燥膜厚0.05μmの塗膜を形成した。

【0104】との塗膜にナイロン製の布を巻きつけたロールを有するラビングマシーンにより、ロールの回転数500rpm、ステージ移動速度1cm/秒でラビング処理を行った。

【0105】次に一対のラビンク処理された基板の液晶 配向膜を有する側のそれぞれの外縁に、直径17μmの 酸化アルミニウム球入りエボキシ樹脂接着剤をスクリー ン印刷塗布したのち、一対の基板を液晶配向膜面が相対 30 するようにしかもラビング方向が逆平行になるように重 ね合わせて圧着し、接着剤を硬化させた。

【0106】次いで液晶注入口より一対の基板間に、ネマチック型液晶(メルク社製、ZLI-1565、2293)を充填したのち、エポキシ系接着剤で液晶注入口を封止し、基板の外側の両面に偏光板を、偏光板の偏光方向がそれぞれの基板の液晶配向膜のラビング方向と一致するように貼り合わせ、液晶表示素子を作製した。

[0107] 得られた液晶表示素子の配向性は良好であり、液晶をZLI-1565、2293とした時のプレ40 チルト角を測定したところ、それぞれ3.5、4.6であった。

【0108】実施例2~12

実施例1において、合成例4、7、10、13、14、17、18、21、22、23、24、25で得られた特定重合体(11a~11k)を用いた以外は、実施例1と同様にして液晶表示素子を作製し、その配向性およびプレチルト角を測定し、結果を表1に示した。

[0109]

【表1】

表1

実施例	特定重合体	プレチルド角(゜)		液晶配向性
		ZLI-1565	ZL 1-2293	
2	Ila	4.4	4.6	良好
3	IIb	4.9	5.0	凬上
4	Ilc	3.0	3.1	配上
5	Ild	3.3	5.0	同上
6	I l e	5.9	7.2	配上
7	Ilf	3.6	6.3	配上
8	IIg	4.8	7.8	配上
9	Ilh	3.9	6.6	同上
10	I I i	12.0	13.4	同上
11	IIj	4.2	5.4	配上
1 2	Ilk	3.6	4.0	同上

【0110】比較例1

合成例25で得られた特定重合体 II1を用いた以外は、実施例1と同様にして液晶表示素子を作製し、その評価を行ったところ、プレチルト角は2.5°であった。

[0111]

【発明の効果】本発明の液晶配向剤によれば、配向性が良好で、かつ、2~90°のプレチルト角を発現し、STNまたはSH表示素子用として好適な液晶配向膜が得られる。

【0112】また本発明の液晶配向剤を用いて形成した 液晶配向膜を有する液晶表示素子は、使用する液晶を選 40 択するととにより、強誘電表示素子にも好適に使用する ととができる。

30 【0113】さらに、本発明の液晶配向剤を用いて形成した液晶配向膜を有する液晶表示素子は、液晶の配向性および信頼性に優れ、種々の装置に有効に使用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、係数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビなどの表示装置に用いられる。

【化5】

$$H_2N \xrightarrow{\text{CH}_2}_{p} Si \xrightarrow{\text{C}}_{p} Si \xrightarrow{\text{C}}_{q} CH_2 \xrightarrow{\text{P}}_{p} NH_2$$

